

| Geräteparameter | NPP-1 |
|--|--|
| Positionier-Messbereich | Fläche Ø 100 mm |
| Laterale Messauflösung | ≤ 0,02 nm |
| Reproduzierbarkeit | < 2 nm |
| Verfahrenbereich in rz | max. 60 arcsec, Nullpunktregelung |
| Metrologische Rückführbarkeit | 3 fasergekoppelte Differenzlaserinterferometer |
| Laserwellenlänge | 633 nm |
| Frequenzstabilität der Laser | < 2 · 10 ⁻⁸ |
| Positioniergeschwindigkeit | 20 mm/s |
| Bahntreue / RMS Servo-Error | < 2 nm RMS |
| Spiegelgrundkörper | Zerodur oder Quarz |
| Aufnahme der Wafer mit Waferchuck, optional | keramisch |
| Nutzlast | 5 kg |
| Positionierbetrieb | Punkt-zu-Punkt, Bahngenerator |
| Benötigte Medien | Druckluft 6 bar, gefiltert, getrocknet, entölt |
| AFM (mögliche Optionen) | |
| AFM-Messung (Kraftregelung) | |
| Lithography Mode, FN-Emission Regelung | |
| FN-Stromquelle | |
| x, y, z, Piezoscanner | 30 x 30 x 10 µm |
| Linearisierung | kapazitiv |
| Long-range Visualisierungsoptik | |
| Geometrische Daten | |
| Abmessungen (B x T x H): | 820 x 710 x 800 mm |
| Masse: | 300 kg |
| Elektronische Daten | |
| Schnittstellen Standard | RS232C, USB |
| Andere Schnittstellen auf Anfrage | |
| Kabellänge zwischen Sensorkopf und Elektronikeinheit | 3 m, optional bis 10 m |
| Spannungsversorgung | 100...240 VAC / 47...63 Hz |
| Laserschutzklasse nach EN 60825-1:2014 und ANSI Z136.1 (CDRH) | 2M II |

04/2022 · Änderungen vorbehalten.